(19)日本国特許庁 (JP)

(12)特許公報(B1)

(11)特許番号 特許第3088102号 (P3088102)

(45)発行日 平成12年9月18日(2000.9.18)

(24) 登録日 平成12年7月14日(2000.7.14)

(51) Int.CL1 H01J 9/02 推测配号

PΙ HO1J 9/02

E

前求項の数14(全 18 頁)

最終更に続く

中級平11-120206 P成11年4月27日(1999.4.27)	(73)特許権者	000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子 3 丁目30書 2 号
	(72)発明者	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
	(72)発明者	
	(72) 発明者	
		<b>華井</b> 明
F成11年6月8日(1989.6.8)	l	東京都大田区下丸子3 「日30番2号 キ
<b>●順平10−122533</b>		ヤノン株式会社内
F成10年5月1日(1998.5.1)	(72)発明者	女事 祥一
本 (JP)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
<b> 瀬平  1-47  2 </b>		ヤノン株式会社内
F成11年2月24日(1999.2.24)	(72)発明者	<b>学</b> 文夫
<b>3</b> ★ (JP)	1	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
<b>  順平</b> 11-49195	1	ヤノン株式会社内
F成11年2月25日(1999, 2, 25)	(74)代理人	100085385
本 (JP)		<b>弁理士 山下 養平</b>
	***	波多江 進
	成10年5月1日(1998.5.1)  本 (JP)  瀬平11-47121  成11年2月24日(1999.2.24)  本 (JP)  瀬平11-49195  成11年2月25日(1999.2.25)	域10年5月1日(1998.5.1) (72)発明者   本 (179)     編甲11-47/21 (72) (72)発明者   本 (179)     編甲11-49(185 (74)代理人

(54) 【発明の名称】 電子製及び面像形成装置の製造方法

(37)【特許請求の顧用】

【請求項1】 基板上に配置された複数のX方向配線 と、前記X方向配線と交差する複数のY方向影線と、前 記×方向配線とY方向配線とを電気的に絶縁する絶縁層 と、前記X方向配線とY方向配線とに電気的に接続さ れ、それぞれに間隙を有する複数の導電性膜とから構成 される電子源の製造方法であって、

前記複数のX方向配線と前記複数のY方向配線とに接続 する複数の導電性膜を配置する導電性膜配置ステップ

前記複数のX方向配線を、各々のグループが複数のX方 向配線から構成されるように、複数のグループに分け、 前記各々のグループを構成するそれぞれの配線間に、他 のグループを構成するX方向配線が存在するようにし、 1つのグループを構成するすべてのX方向配線に同時に

電圧を印加する工程を、順次別のグループに続すことに より、前記複数の導電性膜のそれぞれに間隙を形成する **浦電フォーミングステップレを会み** 

前記通電フォーミングステップにおいて、

一つのグループを構成するX方向配線と、前記一つのグ ループに続いて電圧が印加される別のグループを構成す るX方向配線との間に、他の別のグループを構成するX 方向配線が存在するようにすることを特徴とする電子源 の製造方法

【請求項2】 1つのグループに対して行われる前記電 圧の印加は、予め決められたインターバルを置いて複数 回行われることを特徴とする請求項1記載の電子源の製 造方法.

【請求項3】 前記電圧の印加は、前記一つのグループ に前記電圧を印加する期間が終了した後で、引き続い

3 て、前記別のグループに前記電圧を印加する期間を開始 することを特徴とする請求項1.2のいずれか一つに記 載された電子湖の製造方法。

【請求項4】 1つのグループに対する電圧印加のイン ターバル中に、残るその他のグループへの上記電圧印加 が行われることを特徴とする請求項1、2のいずれか一 つに記載された電子源の製造方法。

【請求項5】 前記印加される電圧の値が、少なくとも 2種類の電圧値であることを特徴とする請求項2記載の 電子源の製造方法。

【請求項6】 前記電圧値が、漸増することを特徴とす る譲渡項与記載の電子源の製造方法。

【請求項7】 前記印加される電圧の値が、一定である ことを特徴とする請求項2記載の電子派の製造方法。 【請求項8】 前記進営性際は、酸化物からなり、前記 フォーミングステップは、前記酸化物を選元する気体を 前記導電性膜に接触させた状態で行われることを特徴と する請求項1万至7のいずれか一つに記載された電子派 の製造方法。

【請求項9】 前記還元する気体が、水素を含むことを 20 特徴とする請求項8記載の電子源の製造方法、

【請求項10】 前記閣職近傍に、有機物を含むガスを 接触させた状態で、前記各導電性膜に電圧を印加するこ とで、前記間除近傍の溥電性膜上に炭素膜を形成する活 性化ステップを有することを特徴とする請求項1乃至9 のいずれか一つに記載された電子源の製造方法。

【請求項11】 前記活性化工程において、前記導電性 膜に印加される電圧は西極性の電圧であることを特徴と する請求項10記憶の電子源の製造方法。

された画像形成部材を有する基板とから構成される画像 形成装置の製造方法であって、

請求項1乃至11のいずれか一つに記載された電子源の 製造方法を用いて前記電子源を製造することを特徴とす る画像形成装置の製造方法。

【請求項13】 基板上に配置された複数のX方向配線 と、前記×方向配線と交差する複数のY方向配線と、前 記×方向配線とY方向配線とを電気的に絶縁する絶縁層 と、前記×方向配線とY方向配線とに電気的に接続さ れ、それぞれに間隙を有する複数の運電性膜とから構成 40

される電子源の製造装置であって、前記×方向配線に印 加する通電フォーミング電圧を発生する通電フォーミン グ電圧発生手段と、

複数のX方向配線を選択して前記通常フォーミング電圧 発生手段に接続し、続いて、前記選択したX方向配線と は別の複数のX方向配線を選択して前記通電フォーミン グ電圧発生手段に接続する配線切替手段とを備え、 前記配線切替手段は、前記選択した複数のX方向配線と 前記選択した別の複数のX方向配線同十は隣り合うこと

# 装置.

【請求項14】 基板上に配置された複数のX方向配線 と、前記X方向配線と交差する複数のY方向配線と、前 記×方向配線とY方向配線とを電気的に絶縁する絶縁層 と、前記×方向配線とY方向配線とに電気的に接続さ れ、それぞれに間隙を有する複数の導電性膜とから構成 される電子源と、前記電子源に対抗して配置された画像 形成都材とを備えた画像形成装置の製造装置であって 前記X方向配線に印加する通常フォーミング電圧を発生 10 する通電フォーミング電圧発生手段と、

複数のX方向配線を選択して前記通電フォーミング電圧 発生手段に接続し、続いて、前記選択したメ方向配線と は別の複数のX方向配線を選択して前記過電フォーミン グ電圧発生手段に接続する影線切響手段とを備え 前記配線切響手段は、前記選択した複数のメ方向配線と 前記選択した別の複数のX方向配線同士は隣り合うこと がないように選択を行うことを特徴とする画像形成装置 の製造装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001] 【発明が属する技術分野】本発明は、電子源の製造方法 及びその電子源を用いた画像形成装置の製造方法、並び にフォーミング方法に関する。 [0002] 【従来の技術】従来、電子放出業子として熱陰極業子と

冷陰極楽子の2種類が知られている、このうち冷陰極楽 子では、たとえば電界放出(FE)型や、金属/絶縁層 /金属(MIM)型や、表面伝導型等が知られている。 [0003] FE型の例としては、W. P. Dyke 【請求項12】 電子源と、前記電子源に対向して配置 30 & W.W.Dolan "Fieldemissio n". Advanced 12Electron Ph ysics, 8, 89 (1956) P. C. A. Spi ndt "PhysicalPropertiesof thin film field emission catodes withmolybdenlum cones", J. Appl. Phys., 47, 52

> 【0004】又、M1M型の例としては、CC.A.M ead "Operation of tunnel emission Devices", J. Appl. Phys., 32,646 (1961) 等が知られてい

48(1976) 箸が知られている...

【0005】又、表面伝導型電子放出妻子としては、た とえば特開平7-235255号公報に構造、製造方法 の一例が開示されている、また、同公報には表面伝導型 電子放出素子を基板上に多数配置した電子源及びこれを 用いた画像形成装置の例も開示されている 【0006】図10は、上記特開平7-235255号

公報に開示された表面伝導型電子放出業子の構造を示す がないように選択を行うことを特徴とする電子源の製造 50 模式図(平面図)である。1は基板を示す、一対の素子 電極2. 3が基板上に対向して配置されており、導電性 膜4が該業子電極の両方に接続されるように配置され る。上記導電性膜には電子放出部5が形成されている。 なお、図では電子放出部5は素子電板の間の中央付近に まっすぐに描かれているが、実際には屈曲したり、一方 の業子電極のすぐ側に形成されている場合もある。

【0007】上記特開平7-235255号公報には更 に、表面伝導型電子放出素子の詳細な構造も開示されて W. 5.

【0008】図11にその新面を模式的に示す。 護雲件 10 隣4の一部には間隙があり、その間隙付近に炭素を主成 分とする膜が配されている。図に示すように、炭素を主 成分とする膜6は、少なくとも帯電性膜4の間隙の内側 にも配されている。導電性膜4の一部に配された間隙 は、素子電極2、3の間に電圧を印加して導電性膜4に **地流を流すことによって形成される。このように電流を** 消して運営性離4に間跡を形成する処理を通常フォーミ ング。又は単にフォーミングと呼ぶ、フォーミング処理 においてパルス電圧を印加することも上記特開平7-2 35255号公報に開示されている。更には、水素など 20 の機元件を有するガスを含む雰囲気下で 会開館化物上 りなる導電性膜にフォーミング処理を施すことにより、 フォーミングに要する電力が低減でき、上記目的を更に 効果的に達成しうることが、特勝平6-12997号公 報や特開平9-298029号公報に開示されている。 【0009】又、上紀の炭素を主成分とする膜6を形成 する処理を通電活性化、又は単に活性化と呼ぶ、この活 性化処理は、フォーミング処理を施した電子放出素子 を、有機物質のガスを含む雰囲気中に設置して、一対の 実行される。活性化処理を複数の電子放出素子に施す方 法は、特別平9-73859号公報や特別平9-134 666号公報に開示されている。

【0010】上紀の電子放出業子を基板上に多数配置し て、図12に模式的に示す様にマトリクス状の配線で接 続して形成した電子源が、本出額人により提案されてい る。上記説明の中で引用した本出版人により出願された 特許公報においても、この構造の電子運が開示されてい も、図で積方向に延びた配線12をX方向配線又は行方 向配線、縦方向に延びた配線13をY方向配線または列 40 方向配線、と呼ぶことにする。X方向配線とY方向配線 との交差部には両者を蓄気的に絶縁するために 図示! ない層間絶縁層が設けられている。 [10011]

【発明が解決しようとする課題】このようなマトリクス 状の電子源にフォーミング処理を施す場合、たとえば、 X方向配線にバルス電圧を印加し、Y方向配線はまとめ てグランドに接続することも考えられるが、製造時間の 観点のみからは、すべての導電性際に同時にフォーミン れらの方法を取ると、配線を流れる電流量が増大する。 このため配線での電圧降下の影響が大きくなり、導電性 膜4に印加されるフォーミング電圧がばらついて、各導 電性膜4に形成される間隙の形状が不均一になる場合が ある。その結果、素子特性がばらつく、又、最悪の場合 は配線を損傷する。又、製造装置の問題として、フォー ミング電圧を印加する装置の電流容量を大きくする必要 がある.

【0012】又、基板上の電子放出業子の数が多くなる と 上述の方法では、フォーミング処理中の発熱により 基板が変形し、最悪の場合には破壊する場合がある。そ こで、フォーミングの際は、基板上の電子放出業子を 行方向配線線単位、列方向配線線単位、又は、行方向配 線線単位及び列方向配線線単位を複数個組み合わせた単 位等でいくつかのブロックに分け、フォーミング電圧の 印加をブロック単位で切り替えることで、フォーミング T程の時間短縮と発熱量の抑制を図ることが考えられ る。しかし、それでも、画像表示装置の大画面化に伴っ

て、基板上の電子放出業子の数が多くなると、適電フォ ニミング工程において基板が変形し最悪の場合には破壊 するという問題がおきる場合がある。 【0013】図20を参照して、以下、基板の変形・破

塊の原因についての本発明者の検討結果について説明す る、図中、4101は電子源基板であり、その材質は研 子である。4102は行方向配線(X方向配線)、41 03は列方向配線 (Y方向配線) であり、図示しない表 面伝導型電子放出業子を構成する導電成隊は行方向配線 及び列方向配線によってマトリクス状に結構されてい る。このような構成の電子測基板において表面伝導型電 素子電極間にパルス電圧を繰り返し印加することにより 30 子放出業子を、たとえば隣接する行方向も本を単位とし て1番からM/b番のブロックにこれらのブロックを順 次切り替えてフォーミング電圧を印加するものとする。 【0014】このようなフォーミング電圧印加方法を取 った場合、フォーミング電圧を印加したブロックに、表 面伝導型電子放出素子を構成する導電性膜を流れる電流

すなわちフォーミング電流に伴う発熱が集中し、基板内 に急峻な温度勾配が発生する。図20には、例として、 ブロック1にフォーミング電圧を自加した時の基板内の 温度分布のグラフを示してある。このように基板内に急 **竣な温度勾配が発生して熟拓力が発生するために、茶板** の変形・破壊が生じることが判明した。

【0015】この時、1ブロック中の表面伝導型電子放 出業子の数を減らしてブロックの数を増やせば、温度上 昇は緩和され、基板の変形・破壊が防止されるが プロ ックの切替が繁雑になり通電フォーミング工程に要する 時間が増大し製造コストを引き上げる点が問題である。 【〇〇16】又、温度上昇の問題を回避する別の方法と して、特開平7 176265号公報に開示されている ように、たとえばX方向配線の内1本を選んで、その配 グ処理を施すことができれば理想的である。しかし、こ 50 線に接続された導電性膜のフォーミングが終了したら、

別のX方向配線を選択してフォーミング処理を行う。こ れを繰りかえすことによって、すべての導電性膜のフォ ーミング処理を行うことが考えられる。しかし、このよ うな方法によると、X方向配線の数が増加するのに比例 して、全導電性膜をフォーミングするのに要する時間が 増大し、生産コストを上昇させる要因となる。

【0017】これに対し、一つのX方向配線にパルス電 圧を1パルス印加した後、別のX方向配線を選択して1 バルス印加し、また別のX方向配線を選択する という 操作を繰り返して、すべてのX方向配線にパルスを印加 10 した後に、最初のX方向配線にバルス電圧を印加する。 そして、この操作を繰り返すことによって、全導電性膜 をフォーミング処理することも考えられる。このような 電圧印加の方法をスクロールと呼ぶことにする、このよ うなスクロール方法は、特別平9-298029号公報 に開示されている。

【0018】上述したスクロール操作では、フォーミン グ処理されるそれぞれの素子から見ると、印加されるパ ルス電圧のデューティすなわちパルス幅をパルス間隔で 削った値、X方向配線の数の逆数以下となる。すなわ ち、X方向配線の数が多くなると、上記のデューティが それに反比例して小さくなる。パルスの波高値が同じで あれば、デューティが小さくなると、フォーミング処理 による間隙の形成は極めてゆっくりと進行し、処理に要 する時間を短縮するという元々の利点が失われる。更 に、還元性ガス中でフォーミング処理を行う場合には、 間隙の形成が進行せずに、還元だけが進行するという別 の問題が生じる。このようになると、配線を流れる電流 が大きくなって配線抵抗による電圧降下が大きくなる。 その結果、素子毎にかかる電圧が相違するために、電子 30 放出素子の特性のばらつきが大きくなるおそれがある 更には、間隙の形成が行われなくなる場合もある。導電 性膜に 1 パルスで係る電力をある程度以上にするために は、パルス電圧を高くする必要があるが、そうすると、 配線を流れる電流が大きくなり、やはり配線抵抗による 電圧降下の影響が大きくなる。従って、スクロール操作 によって運元性雰囲気中でフォーミング処理を行う場合 には、製造することができる電子源の配線数が限定され る。すなわち、製造する電子調が大型である場合には、 過元ガス中でフォーミング処理をする利点が十分には生 40 かされない。しかし、還元ガスを使わずにフォーミング 処理を行うとすると上述のように処理時間が長くなる。 そのため、処理時間を短縮するための工夫が求められて

【11019】そこで、本発明は、多数の配線を有する雪 子源の電子放出業子の電子放出部を短時間でフォーミン グするとともに、フォーミング時の基板の変形・破壊を 防止することを課題としている。

## [0020]

めの本発明は、基板上に配置された複数のX方向配線 と、該X方向配線と交差する複数のY方向配線と、該X 方向配線とY方向配線とを電気的に絶縁する絶縁層と、 該X方向配線とY方向配線とに電気的に接続され、それ ぞれに間隙を有する複数の薄電性膜とから構成される電 子源の製造方法であって、上記複数のX方向配線と上記 複数のY方向配線とに接続する複数の導電性膜を配置す る導電性膜配置ステップと、上記複数のX方向配線を、 各々のグループが複数のX方向配線から構成されるよう に、複数のグループに分け、上記各々のグループを構成 するそれぞれの配線間に、他のグループを構成するX方 向配線が存在するようにし、1つのグループを構成する すべてのX方向配線に同時に電圧を印加する工程を、順 次別のグループに抜すことにより、上記複数の導電性離 のそれぞれに間隙を形成する通電フォーミングステップ とを含み、上記通電フォーミングステップにおいて、一 つのグループを構成するX方向配線と、上記一つのグル ープに続いて電圧が印加される別のグループを構成する X方向配線との間に、他の卵のグループを構成するX方 20 向面線が存在するようにしている。

【0021】以下、図面を参照して本発明の実施の形態 について説明する.

## 【0022】[実施形態1]

【0023】図8は、実施形態1における表示パネルの 斜視図であり、内部構造を示すためにパネルの1 部を切 り欠いて示している。関中、100%はリアプレート、 1006は側壁、1007はフェースプレートであり、 1005~1007により表示パネルの内部を真空に維 持するための気密容器を形成している。容器を組み立て るにあたっては、各部材の接合部に十分な強度と気密性 を保持させるため封着する必要がある。本実施形態にお いては、フリットガラスを接合部に塗布し、大気中で、 摂氏450度で10分以上焼成することにより封着し、 容器を組み立てた。

【0024】リアプレート1005には、基板1001 が固定されているが、この基板上には表面伝導型電子放 出案子1002がn×m個形成されている。(n. mは 2以上の整数であり、目的とする表示画素数に応じて適 宜設定される。たとえば、高品位テレビジョンの表示を 目的とした表示装置においては、n=3000. m=1000以上の数を設定することが望ましい。 本実施形態 においては、n=3072, m=1024とした。) 前 記n・n個の表面伝導型電子放出業子は、m本のX方向 配線1003とn本のY方向配線1004により単純マ トリクス配線されている。前記、1001~1004に よって構成される部分を電子源と呼ぶ。

【0025】図13は、電子源の一部を拡大した平面模 式図である。募板上には、表面伝導型電子放出業子が配 列され、これらの素子はX方向配線電極1003とY方 【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた 50 向配線電攝1004により単純マトリクス状に配線され

ている。X方向配線電極1003とY方向配線電極10 04の交差する部分には、配線間に絶縁層(不図示)が 形成されており、電気的な絶縁が保たれている。

【0026】本実施形態においては、気密容器のリアブ レート1005に電子調の基板1001を固定する構成 としたが、電子源の基板1001が十分な強度を有する ものである場合には、気密容器のリアアレートとして電 子譲の基板1001自体を用いてもよい。

【0027】また、フェースプレート1007の下面に は、蛍光膜1008が形成されている。本実施形態はカ 10 ラスが用いられている。 ラー表示装置であるため、蛍光膜1008の部分にはC RTの分野で用いられる赤、緑、青の3原色の蛍光体が 強り分けられている。

【0028】図14(a)においては、蛍光体は、スト ライブ状に塗り分けられ、蛍光体のストライプの間には 場色部材1010が設けてある。また 3周色の蛍光体 の塗り分け方は図14(a)に示したストライプ状の配 列に限られるものではない。 図14(b)には、たとえ ば、デルタ状配列を示すが、それ以外の配列であっても It.

【0029】蛍光膜1008リアプレート側の面には、 ○RTの分野では公知のアルミニウム(A1)からなる メタルバック1009を設けてある。

[0030] Dx1~Dxm##UDv1~Dvn## び川々は、当該表示パネルと不図示の電気回路とを電気 的に接続するために設けた気密構造の電気接続用端子で ある、Dx1~Dxmは電子源の行方向配線1003 と、Dy1~Dynは電子源の列方向配線1004と、 Hvはフェースプレートのメタルバック1009と電気 的に接続している。

【0031】容器内部を真空に排気するには、容器を組 み立てた後、図示しない排気管と真空ボンプとを接続 し、容器内を10-5Pa程度の真空度まで排気する。そ の後、排気管を封止するすることで気密容器を形成し た。気密容器内の真空度を維持するために、封止後に気 密容器内の所定の位置にゲッター膜 (不閃示)を形成す る。ゲッター膜は、たとえばBaを主成分とするゲッタ 一材料をヒーター若しくは高周波加熱により加熱し蒸着 して形成した膜である。

【0032】次に、本実施形態の表示パネルに用いた電 40 等を用いる 子源の製造方法について説明する。

【0033】(1) まず、図15(a)に示すよう に、基板1101上に素子電極1102及び1103を u ×m組形成する。形成するにあたっては、あらかじめ 基板1101を洗剤、純水、有機溶剤を用いて十分に洗 浄後、素子電極の材料を堆積させる(堆積する方法とし ては、たとえば、蒸着法やスパッタ法などの真空成膜技 術を用いればよい)。その後、堆積した電極材料を、フ オトリソグラフィー、エッチング技術を用いてパターニ

1.0

103を形成する。 【0034】尚、後述するX方向配線とY方向配線に、 表面伝導型電子放出業子を構成する導電性膜を直接接続 できるのであれば、素子電極は省略することができる。 【0035】基板1101としては、例えば、石英ガラ スや青板ガラスをはじめとする各種ガラス基板や、アル ミナをはじめとする各種セラミクス基板、又はこれらの 基板上にたとえばSiOzを材料とする絶縁層を積層し た基板等を用いることができる。本実施形態では青板ガ

【0036】基板1101上に基板面と平行に対向して 設けられた素子電極1102と1103は、導電性を有 する材料によって形成されている。たとえば、Ni、C r, Au, Mo, W. Pt, Ti, Cu, Pd, Agra をはじめとする金属、あるいはこれらの金属の合金、あ るいはIngOs SuOsをはじめとする金属酸化物 ポリシリコンなどの半導体、などの中から適宜材料を選 択して用いればよい、電極を形成するには、たとえば真 奈蒸着などの製機技術とフォトリソグラフィー、エッチ 20 ングなどのパターニング技術を組み合わせて用いれば容 具に形成できるできるが、それ以外の方法(たとえば印 馴技術)を用いて形成してもさしつかえない。本実施形

態においては、Ptで素子電極を形成する。 【0037】第子電板1102と1103の形状は、当 該電子放出業子の応用目的に合わせて適宜設計される。 一般的には、電板間隔しは通常は数百オングストローム から教育umの範囲から適当な教績を選んで設計される が、なかでも表示装置に応用するために好ましいのは数 μmより数十μmの範囲である。ス、素子電極の厚さ d 30 については、通常数百オングストロームから数 umの範

囲から適当な数値が選ばれる。 【0038】(2) 次に、図8、図13に示した10 24本のX方向配線1003と、3072本のY方向配 線1004をそれぞれが、素子電極に接続するように形 成する。尚、又方向配練1003とY方向配練1004 との交差部には絶縁層を配置した。又、X方向配線10 03とY方向配線1004、及び絶縁層は、フォトリソ グラフィを用いて作成する。又、配線の材料としては、 銀(Ag)等を用い、絶縁層の材料としては、SiO。

【0039】(3) 次に、図15に示すように、導電 性膜1104を欠く素子電極対1102,1103間に 形成する。これを形成するにあたっては まず前紀 (a)の基板前面に有機金属溶液を塗布して乾燥し、加 熱焼成処理して導電性膜を成膜した後、フォトリソグラ フィー、エッチングにより所定の形状にバターニングす る。ここで、有機金属溶液とは、導電性腺に用いる材料 を主要元素とする有機金属化合物の溶液である。具体的 には、本実権形態では主要元素としてPd等を用いる、 ングし、(a)に示した一対の菓子電優1102及び1 50 また、本実施形態では頒布方法として、ディッピング法 を用いているが、それ以外のたとえばスピンナー法やス アレー法を用いてもよい。

【0040】導電性膜の膜厚を設定するために考慮すべ き条件には、素子電板1102.1103と電気的に良 好に接続するのに必要な条件、通電フォーミングを良好 に行うのに必要な条件、導電性膜自身の電気抵抗を適切 な値にするのに必要な条件等がある。導電性膜の膜厚 は、具体的には、数オングストロームから数千オングス トロームの範囲の中で設定されるが、特に、10万至5 00オングストロームの間が好適である。 【0041】導電性膜を形成するのに用いられうる材料 としては、たとえば、Pd、Pt、Ru、Ax、Au、 Ti, In, Cu, Cr, Fe, Zn, Sn, Ta, W. Pbなどをはじめとする金属や、PdO. Sn Oz, In2O3、PbO、Sb2O3等をはじめとする酸 化物や、HfB2、ZrBi, LaBs, CeBs, Y B<sub>4</sub>, GdB<sub>4</sub>などをはじめとする確化物や、TiC、Z rC. HfC. TaC. SiC. WCなどをはじめとす る炭化物や、Tin, Zrn、Hinなどをはじめとす る鹽化物や、Si、Geなどをはじめとする半導体や、 カーボンなどがあげられ、これらの中から建宜選択され

【0042】導電性薄膜1104のシート抵抗値につい ては、10°から107Ω/□の範囲に含まれるように設 定する。

【0043】なお、導電性薄膜1104と素子電極11 02および1103とは、電気的に良好に接続されるの が望ましいため、互いの一部が重なりあうような構造を とっている、その重なり方は、図15の例においては、 下から基板、素子電極、導電性薄膜の順で積層したが、 場合によっては下から基板、導電性薄膜、素子電極、の 順序で積層してもさしつかえない。 【0044】以上の工程によって通常フォーミング書の

電子源が形成される。

【0045】(4) 次に、図15(c)に示すよう に、各素子電板1102、1103の間に適宜の電圧を 印加し、通電フォーミング処理を行って、各連電性際に 間隙1106を形成する。

【0046】図1はフォーミング工程を行うための装置 接続し、X方向配線12は配線切り替え器14に接続し ている。配線切り替え器14は電子源11の各X方向配 様を個別に半導体業子またはリレーなどのスイッチング 素子を介してフォーミング電圧発生器15ないLグラン ドに接続しており、このいずれに接続するかの切り替え の制御を各X方向配線毎に個別に行えるようになってい そ、電流計17によりフォーミング電圧発生装置から投 入される電流を検知することが出来る、配線切り替え器 およびフォーミング電圧発生装置の制御、電流計からの

ソコンなどの制御装置16により行う事が出来る。 【0047】本実施形態のフォーミング電圧の印加方法 においては、1グループを6.4本のX方向配線で構成し ている。つまり、1024本のX方向配線を、64本ず つのX方向配線よりなる16のグループに振り分ける。 次に各グループ毎にフォーミング処理のための電圧印加 を行い、一つのグループについて、フォーミング工程が 終了したら上記配線切り替え器を切り替えて次のグルー プに対してフォーミング処理を行うことを繰り返して 10 すべての電子放出業子のフォーミング処理を行う、更 に、各グループのX方向配線は、16本おきに選ばれる ようにした。すなわち、第1のグルーアに属するX方向 配線は、Dx1、Dx17、Dx33、Dx49、…. D×1009 第2のグループに基するのは D×2 Dx18, Dx34, Dx50, ..., Dx1010等と なるように、各グループを設定する。このようにするこ とで、フォーミング処理によるジュール熱の発生を基板 全体で概ね一様にすることが出来る。その結果、基板が 脳所的に高温になり、間隙の形成が裏影響を受けたり 20 熱応力などにより蒸板が損傷するなどの事態を防ぐこと が出来る。

【0048】図2は、第1のグループにフォーミングの ための電圧を印加したときの基板の温度分布を示す模式 図である。なお、本実練形態では、各グループに属する 配線の間隔を厳密に均等になるように設定したが ジュ ール熱の発生がおおむね均一となるように出来れば上記 の効果は得られるので、必ずしも厳密に禁間隔でなくて も良い。

【0049】図3は、フォーミング電圧発生装置内によ り印加されるパルス波形の一例を示す。図に示したの は、パルス幅下1、パルス間隔下2の三角波のパルス電 圧を、バルス波高値Vpfを徐々に上昇させながら印加 する場合である。波高値Pmの矩形波パルスが挿入され ているのは、この時流れる電流をモニタしてフォーミン グ処理の進行状況を検知するためのものである。具体的 には、例えば10-3Pa程度の圧力に排気した真空中に 電子源を設置して、たとえばT1=1msec、、T2 -10msec. として、波高値Vpfを徐々に上昇さ せる。一方フォーミングのための三角波パルスをラパル の概念図である。Y方向配線13は、共通のグランドに 40 ス印加するたびにモニタ用の例えば0.1V程度の被高 値の矩形波パルスPmを印加して 雪漬針により雪漬を 検知して各グループに対するフォーミング処理の終了を 決定する。例えば一葉子あたりの抵抗値が1 MΩを超え た時点で当該グループの処理を終了して 配線切り替え 装により電圧を印加する配線を変更して、次のグループ の処理に移る。このような処理を繰り返してフォーミン グ工程が終了する。

【0030】X方向配線の本数が多い場合には、上述の 方法によって、フォーミング処理にかかる時間を、N方 データの取り込みは適当なインターフェースを通じてバ 50 向配線1本ずつについてフォーミング処理を行う場合に

比べて、大幅に短縮することが出来る。尚、ここでは、 一つのグループに属するX方向配線の数を64本とした が、これは電子放出業子や配線の設計により適宜選択す れば良い。

【0051】図4は、本実施形態のフォーミング工程を 示すフローチャートである。本実施形態においては、フ ォーミング前の電子湖の状態で封着し、容器を形成した 後で、フォーミング工程を実施している。

【0052】(5) 次に、図15(d)に示すよう に、活性化用電源から各業子1102.1103の間に 10 演賞の電圧を印加し、 通電活性化処理を行う、具体的に は、フォーミングを終えた容器内を、1.3×10-1万 至1. 3×10-3 Paの範囲内の真空雰囲気に保持 し、パルスを定期的に各連営性際に印加することによっ て、雰囲気中に存在する有機化合物を減として炭素膜1 110を堆積させる、

【0053】図16(a)(b)には、活性化電源から 印加する適宜の電圧の波形の例を示す。本実施形態にお いては、図16(a)に示した両極性の一定電圧の矩形 は、矩形波の電圧はプラス・マイナス14V、パルス幅 F3は1ミリ秒、パルス間隔T4は10ミリ秒等とする とよい。

【0054】次に、容器を加熱しつつ、容器内を10 Pa程度まで排気管を介して排気する。その後、排 気管を對止して気密容器を形成する。

【0055】以上の工程によって作製した本実験形骸の 表示装置を駆動したところ、均一性に優れた高輝度の画 像が得られた。

施形態1に示したのと同様の電子源について、X方向配 検を実施形態1と同様にグループ化し、この各グループ に対するパルス電圧の印加を前述したスクロールの方法 によって行う。

【0057】図5は、本実施形態のフォーミング工程を 行うのに用いる装置の構成の一例を示す模式図である。 本装置におけるフォーミング電圧発生器15は16個の 出力端子を備え、それぞれにパルスをずらして出力させ ることが出来るものである。配線切り替え器14はフォ 配線、出力端子2とグループ2のX方向配線、と言うよ うに出力端子と配線を接続している。実施形態1と同じ 装置を用いても以下の方法は実行できるが、その場合配 線切り替え器の切り替え速度が極めて高速であることが 要求される. 本実施形態の装置では、フォーミングパル ス発生装置15に複数の出力端子が必要となり、各出力 **柴子に順次パルスを出力する機能が要求されるが、配線** 切り替え器14の動作はそれほど高速である必要はな い、配線切り替え器の業子に機械式リレースイッチのよ うな業子を用いる場合には、このような構成の装置が適 50 を順次印加することで、単位時間当たりの電子源基板で

している。 【0058】本実施形態におけるグルーア化方法は、1 024本のX方向配線12を、実施形態1で説明したの と間様に、6.4本ずつのX方向配線よりなる1.6のグル ープに振り分ける。各グループへのバルスの印加の仕方 を図6により説明する。配種切り替え器により、フォー ミング電圧発生器により生成されたパルスを1パルス毎 に印加するグループを切り替える。

【0059】図6に示すように、グルーア1にバルスを

印加した後、配線切り響え器により、グループ2に配線 ヘフォーミング管圧発生器をつたぎ替え 1パルスを印 加する。この操作を繰り返して、グルーフ16までパル スの印加を行った後、再びグループ1からパルスの印加 を繰り返す。図では、各グループへのパルス電圧の印加 を一欄する毎にパルス波高値Vpを徐々に上昇させる場 合を示している。一つのグループから見たときのバルス 幅T1とパルス間隔T2の関係は、グループの数をNと 表わすと、必然的にT1至T2、Nとなる、上述のよう に配線をグループに分けた場合、T1≤T2×16であ 液を定期的に印加して通電活性化処理を行う。具体的に 20 る。例えばT1=1msec.とした場合。T2≥16 msecである。但し、本実施形態においては、連続す るグループ、たとえばグループ1とグループ2で選択す るメ方向配線同士も間隔が開くように選択している。つ まり、フォーミング電圧が印加された或グループを構成 するX方向配線と、その次にフォーミング電圧が印加さ れる別のグループを構成するX方向配線との間には他の グループを構成するX方向配線が存在している。本実施 形態においては、フォーミング工程に要する時間を増齢 するために、連続するグループにおいてフォーミング電 【0056】 [実施形態2] 本実施形態においては、実 30 圧のバルスが短い間隔で印加される。従って、連続する グループ間で、各々X方向配線の間隔を空けることが、 フォーミング電圧の印加に伴う発熱を電子源基板上で機 ね均一とさせるのに効果的である。 【0060】図17に示すように、具体的には、グルー ブ1はX方向配線の番号1、17、33、49、…、1 + (m/i) \* (i - 1) を選択し、グループ 2は5. 5+16, 5+32, ..., 5+(m i) \* (i-1) を選択し、グループドはY方向配線の番号a(k).a (k) + 16, a(k) + 32, ..., a(k) + (m < m)ーミング電圧発生器の出力端子1とグループ1のX方向 40 i)\*(i-1)を選択する。ここで、mはX方向配線 の総本数であり本実施形態においては1024である 又、1はグループの総数であり本実施形態においては1

> 設定した。a(k)の値については、電子源基板上の発 熱を概均一にすることができればこの設定の仕方に限る 必要はない。 【0061】ところで、各グループにフォーミング電圧

6である。但し、本実施形骸では、a(k)の値はk=

1からm/iに対し、1,5,13,2,6,10,1

4. 3. 7. 11. 15. 4. 8. 12. 16のように

の発熱量は増大することになる。しかしながら基板の破 地および変形を起こす原因は発熱量の絶対値よりむし ろ、基板上での発熱の集中に起因すと考えられる。その ため、本実施形態のように基板上での発熱を概ね均一に するようなフォーミング電圧印加方法をとれば基板の破 壊または変形を起こすことはない。以上説明したよう に、本実施形態の通電フォーミング工程では、実施形態 1に比べ工程に要する時間を非常に短縮できる上、フォ ーミング電圧の印加に伴う電子調基板の変形または破壊 をより効果的に防ぐことができる。

【0062】 [実施形態3] 本実施形態では、印刷法と インクジェット法を用いて、配線、電極ならびに導電性 膜を形成した。また、本実施形態のフォーミング方法 は、実施形態2と基本的に同様であるが、還元性雰囲気 中で行った。つまり、電圧印加が連続する2つのグルー アを構成するX方向配線間に他のグループのX方向配線 が存在する。以下、図8、図18、図19を参照して本 実施形態の製造方法について、実施形態に即して説明す る。尚、図18、19では、説明を簡略化するために、 9個の電子放出素子しか図示していないが、実際には、 180×2142個形成した。

### 【0063】工程-1:電極形成工程

洗浄した青板ガラス上に、CVD法によりSiOz 階を 被膜し基板1とした。次に、Ptの有機化合物を含むイ ンクを使用したオフセット印刷法を用いて、Ptからな る一対の電攝2、3を480×2442組形成した(図 18(a))、尚、各案子電極対の間隔は20μmに設 計した.

#### 【0064】工程-2:配線形成工程

Y方向配線13をAgを主成分とするペーストを使用!。30 有する。本家練形骸ではX方向配線80本おきに1本ず たスクリーン印刷法を用いて2442本形成した(図1 8(b))、次いでガラスペーストを使用してスクリー ン印刷法で、絶縁層14を形成した(図18 (c))... 更に銀(Ag)を主成分とするペーストを用いて、上記 スクリーン印刷法でX方向配線12を480本形成した (図19(a))。本実施形態において、X方向配線は 480本、Y方向配線は2442本を形成した。 【0065】工程-3:疎水化処理工程

次に、上記電極と配線、層間絶縁層の形成された基板 を、シランカップリング剤を用いて、疎水化処理を行っ 40

# 【1)066】工程-4:導電性膜形成工程

インクジェット装置を用いて、有機Pd化合物を含む水 溶液を各電極対2.3に跨るように付与した。その後付 与した水溶液を乾燥させて、有機Pd化合物の膜を形成 した。その後有機Pd膜を350℃で熱処理することに より、主にPdOよりなる導電性膜4を形成した(図1 9(b))、以上の工程により、フォーミング前の電子 源基板を作成した..

【0067】 工程 - 5:フェースプレート作成工程

ガラス基体1007上に、蛍光体とブラックマトリクス からなる蛍光膜1008を印刷法により形成した。次い でA 1 を真空蒸着法により成膜してメタルバック100 9を形成した。

【0068】工程-6:封着工程

(8)

フォーミング前の電子激基板と上記フェースアレート、 および支持枠を図8のように組合せて、接合部に配され たフリットガラスを加熱溶融させ接着して外囲器28を 横成した、尚、本実施形態では、電子源基板をリアプレ 10 ートとして用いた。図示していないが、外囲器28の内 都には、電子源(リアプレート)とフェースプレートの 間に、両者の間隔を一定に保つためのスペーサ、および 面像形成装置として完成した後に、外囲器内の圧力を低 く保つためのゲッタを配置した。又、図示していない が、外囲器内部を排気したり、各工程において必要なガ スなどを導入するための排気管が外囲器に接続されてい る。又、高圧接続端子87は外囲器88の内部で上記メ タルバック1009に接続されている、メタルバック は、画像形成装置として駆動される際に、高圧電源に接 20 綾される.

# 【0069】工程-7:フォーミング工程

図8のY方向配線の外部端子Doy1, Doy2, …. Doy2442を全てグランドに接続し、X方向配線の 外部端子Dox1, Dox2, …, Dox480を各行 に対応するドライバーの出力端子に接続する。本実施形 態に用いたドライバーは、480本のX方向配線のそれ ぞれに対応して独立したパルス発生器を備えたものであ る。上紀ドライバーは、各パルス発生器のそれぞれが発 生するパルスのタイミングを適宜調整できる制御機能も つ、合計6本の配線で一つのグループを構成する様にグ ループ化を行った。グループの総数は80である。図6 に示すように、前述したスクロールの方法で、パルス電 圧を印加してフォーミングを行った。つまり、1つのグ ループに印加されるパルス状電圧の、パルス間隔下2 (インターバル)の間に、その他の全てのグループへハ ルス状電圧を印加するという手順を繰り返し行った。但 し、各グループへのパルス電圧の印加が、同時に行われ ることはない。尚、図6は三角波パルスで示されている が、本実錬形態は単にパルスの形状を矩形波にした。な お、このスクロールの方法においては、各グループに電 圧を印加する順序は、各グループを構成するド方向配線 同士が隣接するグループに、連続して電圧が印加されな いように設定した。具体的には、第1パルス電圧は、1 番目のX方向配線から80本おきに選んだX方向配線 (「グループ1!と呼ぶ)全てに対して同時に印加し た。第2パルス電圧は、41番目から80本おきに選ん だX方向配線(グループ41)全てに対して同時に印加 した。以下同様にして、電圧が印加されたグルーフを構

50 成するX方向配線と、その次に電圧が印加されるグルー

アを構成するX方向配線との間に、他のグループを構成 するX方向配線が配される様に電圧を印加する。この様 にして、全てのグループにパルス電圧を印加した後、再 度、同様にして各グループにパルス電圧を繰り返し印加 した。このフォーミング工程を具体的に述べる、上記封 着した外囲器に接続した排気管を、排気装置、およびカ ス導入装置などを備える真空装置に接続して、まず外囲 器全体を50℃に保持しながら内部を排気する。真空装 置の上記排気管への接続部直近に配置した圧力計で測定 した圧力が10-6Pa程度となったところで、上述した 10 ようなスクロールのフォーミング方法によりパルスの印 加を開始する。この時印加したパルスは、波高値10V の矩形波パルスで、パルス幅3msec、パルス間隔8 80msecであり、上記のように選択される各グルー プに11msecずつずれてパルスが印加されるように タイミングを制御した。パルス印加を開始した後5秒後 に真空装置内にN2 98%-H2 2%の混合ガスを導入 したところ、この直後にすべての妻子に対するフォーミ ング処理が完了した。

### 【0070】工程-8:活性化工程

フォーミング工程が終了後、外囲器内部を再度排気し た、その後、外囲器内にベンゾニトリルを導入した。圧 力は真空装置の排気管付近の圧力計の測定値で1.3× 10-1Pa程度となるように導入量を制御した。この処 埋では、まず、X方向配線480本を、図7に示すよう に1つのグループを連続するX方向配線10本から構成 し、合計48グループに振り分けた。本実施形態では、 各グループ毎に活性化処理を順次終了させていった。つ まり、第1グループの活性化を終了後、第2グループの 活性化を開始し、第2グループの活性化が終了後、第3 30 ブループの活性化を開始するという手順で、48グルー アすべての活性化処理を完了した。尚、それぞれのグル ープにおける活性化のための電圧印加は、前述のスクロ ールの方法により、各X方向配線にバルス状電圧をOffice した。つまり、1本のX方向配線にパルスを印加してか 5、次のパルスが印加されるまでの間に、他の全てのX 方向配線にパルスを印加した。但し、各X方向配線に印 加されるパルスが同時に印加されることはない。本実施 形態における活性化処理ではパルス幅1msec、パル ス間隔10msec、波高値14Vの矩形波パルスを用 40 いた。以上の工程により電子放出部5を形成した(図] 9 (c)).

【0071】工程-9:安定化工程

活性化工程を終了した後、排気装置により外囲器内を排 気しながら外囲器を200℃に10時間保持した。この 時点で真空装置の圧力計の値は、1、3×10-5Paで

【0072】工程-10:封止工程

外囲器中に配置したゲッタを高周波加熱することによ

じ切った。上紀のようにして形成した画像形成装置を画 像表示用の駆動回路に接続し、高圧接続端子を介して上 記メタルバックに5kVの電圧を印加して、画像を表示 し、均一性の良い良好な画像を表示できることを確かめ t.

【0073】 [実施形態4] 本実施形態では、フォーミ ング工程、活性化工程を施した後に外囲器の封着工程を 行った。それ以外は実施形態3と同様である。以下、本 実施形態で作成した電子源および画像形成装置の製造工 程を記す。工程1~4は、実施形態3と同様にしてフォ ーミング前の電子運を形成した。 続いて フォーミング 前の電子源基板を真空チャンバー中に設置した。真空チ ャンパー中には、上記電極などの形成された基板(以 下、便宜的に「電子波」と呼ぶ)のX方向配舗、Y方向 配線に接続する接続端子が設けられており、上記真空チ ャンパー外から各配線に電圧を印加することができる。 また、真空排気装置で内部を排気すると同時に、所望の ガスを導入することができ、内部の雰囲気を制御するこ とができるものである。実施形態3の工程-7および工 20 程~8と同様の方法で、フォーミング処理、活性化処理 を施した。その後、工程-6に対応する封着工程によ り、外囲器を形成した、本実施形態の封着工程では、不 活性ガス(具体的にはAFガス中において、都材を組み 合わせ、フリットガラスを用いて、加熱し接着し外囲器 を形成した。続いて、実施形態3の工程…9と同様に安 定化工程、工程-10と同様にゲッタ処理を行い、つい で排気管を封じ切り気密容器を形成した。本実施形態の 方法により形成された画像形成装置は、実施形態3で形 成された画像形成装置と同様に、均一性の良い、良好な

画像を表示することができた。 【0074】[参考形態5]

本参考形態においては、表示パネルの構成及び製造方法 は実施形態1と同様である。本参考形態では、隣接する X方向配線2本を単位とし、この単位をi個選択して つのグループを形成した。本参考形態では1=32とし m/(2\*i)個(16個)のグループに振り分けた。 ここで、mはX方向配線の総数であり1024とした 各グループを構成する単位は、おのおの((m/i) 2)本(本参考形態では30本)のX方向配線の間隔を 空けて均等に選択した。図9に示すように、具体的に は、グループ1はX方向配線の番号1.2,33.3

4. ... 1  $\vdash$  (m  $\land$  i )  $\Rightarrow$  (i = 1) . 2  $\vdash$  (m  $\succ$  i ) \* (i-1)を選択し、グループ k は k . k-1 . k+ 32, k+1+32, ... k+(m-1)\*(i-1) . k+1+(m/1)\*(i 1;の)X方向配線を 選択し、グループ化した。

【0075】以下、通電フォーミングに用いた装置およ び方法は実施形態1と同様なものを採用した。

【0076】本参考形態では、グループを構成する単位 り、ゲッタ処理を行い、次いで排気管を無してこれを封 50 が隣接するX方向配線2本であるため実施形態1と比較

して、基板内の温度分布の均一性は低くなるが、同一グ ループに属する配線がすべて連続する場合より基板温度 の均一性を改善する効果が有る。

【0077】[実施形態6]本実施形態においては、実 施形態1と類似のX方向配線のグループの設定を行った 場合について、異なる電圧印加方法を採用する。すなわ ち、X方向配線全体をほぼ同数の複数のグループに分割 し、それぞれのグループ毎に、従来のスクロール方法で フォーミング処理を行う、具体的には、各グループは、 Dx1. Dx103, Dx205, ..., 1/v-72 はDx2. Dx104. Dx206. · · · 、等からな る、但し、X方向配線の総数が10で割り切れない場合 は、余った配線は適宜いずれかのグループに割り扱る。 【0078】そして、まず、グルーア1に対して適当な パルス電圧を印加するのであるが、この時、従来のスク ロール方法と同時に行う。すなわち、まず、Dx1に1 パルス印加した後、配線切替部によって、Dx103に パルス発生装置を接続して1パルス印加し、更にDx2 ての配線に1パルスずつ印加したところで、再びDx1 に接続を切着、同様の工程を繰り返す。このパルス印加 の繰り返しによって、グループ1の配線についてのフォ ーミング処理が完了したら、グループ2についても同様 の処理を行う。これを繰り返して、すべての電子放出業 子のフォーミング処理を完了させる。

【0079】このような方法を採用する場合、フォーミ ング用パルスのデューティは、一つのグループに属する 配線の数の逆数により限定される。たとえば、デューテ の数は10を越えることはできない。その分グループの 数が多くなり、フォーミング処理時間が長くなるが、Y 方向配線を流れる電流は、常に一つの又方向配線から流 入する分だけであるので、Y方向配線の抵抗による影響 を振めて小さくすることができる。

### 【0080】[参考形態7]

本参考形態は、印刷法とインクジェット法を用いて、配 様. 電極ならびに導電性膜を形成し、次いで上述したフ オーミング工程を行うことにより形成した電子調および 図8、図18、及び図19を参照しつつ説明する。

【0081】工程-1:洗浄した青板ガラストに、CV D法により約80 nmのSiO: 層を形成して、これを 基板1に用い、Ptの有機化合物を含むインクを使用し たオフセット印刷法を用いて、Pも雪板2、3を形成1。 た (図18 (a))。 業子電極の簡隔は20 μm に設計 11.

【(1082】工程-2:Y方向配線13をAgを主成分 とするベーストを使用したスクリーン印刷法を用いて形 2.0

形成した(図18(5)(c))、更に上記Y方向配線 の形成と同様にしてX方向配線12を形成した(図19 (a))、本参考形態において、X方向影響は240 本、Y方向配線は720本を形成した。

【0083】工程-3:次に、上記電極と配線、層間絶 経暦の形成された基体を、シランカップリング剤を用い て、疎水化処理を行った。

【0084】 丁程-4:有機Pd化合物を含む水溶液 を、インクジェット装置により、それぞれの電子放出業 たとえば10本のX方向配線で構成され、グルーア1は 10 子の電極2,3に跨るように液滴として付与し、乾燥さ せて、有機Pd化合物の膜を形成、これを350℃で熱 処理することにより、主にPdO嫩粒子よりなる導電性 膜4を形成した(図19(b))。

【0085】工程-5:フェースプレート1007はガ ラス基体上に蛍光体とブラックマトリクスからなる蛍光 膜1008を印刷法により形成し、次いでアルミニウム (A1)を真空蒸着法により成膜してメタルバック10 09を形成する。

【0086】工程-6:電子源を形成した基板をリアア 05に接続を切り替える。こうして、グループ1のすべ 20 レートとして用い、これを上記フェースアレートおよび 支持枠を図8のように組合せて、フリットガラスにより 接着して外囲器28を構成する。不図示であるが、外囲 器28の内部には、電子源(リアプレート)とフェース アレートの間に、両者の間隔を一定に保つためのスペー サ、および画像形成装置として完成した後に、外囲器内 の圧力を保つためのゲッタが位置される。また、同じく 不図示であるが、外囲器内部を排気したり、各工程にお いて必要なガスなどを導入するための排気管が外開器に 接続されている、また、高圧接続端子27は外囲器28 ※10%とするためには、一つのグループに属する配線 30 の内部で上記メタルバック1009に接続され、面像形 成装置として駆動される際にはメタルバック1009に 電子を加速するための高電圧を印加するために、高圧軟

源に接続される。 【0087】工程-7:本工程は本条項の特徴である フォーミング処理の工程である。図8のY方向配線の外 都囃子Doyl, Doy2,…Doynを全てグランド に接続し、X方向配線の外部端子Dox1、Dox2、 …. Doxmを図1の配線切り替え器に接続する。本参 考形態では、X方向配線を連続する3本毎に一つのグル それを含む画像形成装置の製造方法である。ここでは、 40 ープとし、すなわち1~3番目のX方向配線をグループ 1、4~6番目をグループ2、…、238~240番目 をグループ80として、実施形態2で示したのと同様 に、スクロールの方法でパルス電圧を印加する方法を採 用する。上記、外囲器の排気管を排気装置 お上びガス 導入装置などを備える真空装置に接続して、まず外囲器 全体を50℃に保持しながら内部を排気する。真空装置 の上記排気管への接続部直近に配置した圧力計で測定し た圧力が10-5Pa程度となったところで、上述したよ うなスクロールの方法によりパルスの印加を開始する。 成、次いでガラスペーストを使用して層間絶縁階14を 50 この時印加したパルスは、波高値10Vの矩形波パルス

- で、バルス幅3msec、バルス開隔11msecであ り、該バルス開降に等しい、11msecおきに、上記 配縁切り替え器により、選択するグループを切り替え て、880msecですべてのグループに1パルスずつ 印加されるようにした。各X方向配線から見ると、パル ス幅3msec、パルス間隔880msecのパルスが 印加されることになる。パルス印加を開始した後5秒後 に真空装置内にN: 98%-H: 2%の混合ガスを導入 したところ、この直接にすべての素子に対するフォーミ ング処理が完了した。なお、同様に作成したものに対 し、上記と同じパルス幅パルス間隔のパルスを同様のス クロールの方法で印加してフォーミング処理を試みたと ころ、フォーミング処理がうまく行われるためにはΦ外 囲器の温度を邀温(約20℃)としN298%-H2 2 %の混合ガスの導入を行わなかった場合には、バルス液 高値を20V程度、ON: 98%-H: 2%の混合ガス の導入は同様に行うが外囲器の温度を築温とした場合に は、パルスは高値を14V程度とすることが必要であっ た。これは、フォーミング処理中の、導電性膜の還元の の温度に保持するのが好ましいかは、導電性膜の材質、 それを構成する微粒子の形状、描元性ガスの種類と圧力 などにより異なると考えられ、状況に応じて適当な温度 に保持しながらフォーミング処理を行うようにするのが 好ましい。フォーミング工程が終了したら、外囲器内部
- を再度排気する。 【0088】工程-8:練いて、活件化処理を行う、外 囲器内にベンゾニトリルを導入する。 圧力は真空装置の 排気管付近の圧力計の測定値で1. 3×10-8Pa程度 級1本毎を順次スクロールする方法で、活性化処理のた

めのパルス印加を行った。パルス幅3msec. 波高線

14Vの矩形波パルスを用いた。

- 【0089】工程-9:活性化工程を終了した後、安定 化工程を施した。排気装置により外囲器内を排気装置に より外囲器内を排気しながら外囲器を200℃に10時 簡保持した。この時点で真空装置の圧力計の値は、1. 3×10 Paであった。
- 【0090】工程-10:外囲器中に配置したゲッタを 高周波加熱することにより、ゲッタ処理を行い、次いで 40 を示すブロック図である。 排気管を熱してこれを封じ切った。
- 【0091】上記のようにして形成した画像形成装置を 画像表示用の駆動回路に接続し、高圧接続端子を介して 上記メタルバックに5kVの電圧を印加して、画像を表 示し、均一性の良い良好な画像を表示できることを確か めた。
- 【0092】 「実施形態8] 本実施形態は、以下の点を 除き、実施形態7と同様の手順により行った。本実施形 態の方法により作成した電子源は、実施形態7で作成し

22 向配線は2442本を有するものである。

【0093】フォーミング工程における、スクロールの 方法は、実施形態7とは異なり、X方向配線80本おき に1本ずつ、6本の配線を選択して一つのグループを設 定し、このグループに対して、実施形態7と同様の方法 で電圧印加を行った。このようにした理由は、同時に選 択する配線が実施形態7の場合の2倍となるため、連続 する6本の配線に同時に電圧を印加すると、温度上昇が 大きくなり、何らかの悪影響が出ることが懸念されるた

10 めである。実際、本実施形態よりも小型の実験用の電子 源について、連続する6本の配線を1グループとして処 理した予備的な検討の結果では、一部の配線に接続され た電子放出業子の放出特性(電子放出量)が若干低くな ってしまう傾向が見られた。

【0094】上記の結果から、同時に選択する配線の数 が多くなる場合には、連続した配線を関じグループに設 定すると温度上昇による影響が大きくなるため、とびと びに選択した配線によりグループを設定した方が好まし いと考えられる。どの程度の数以上の場合にこのような 進行速度に関連した減少ではないかと考えているが、ど 20 傾向が顕著になるかは、導電性膜の材質や、還元ガスの 種類や濃度、基板の温度などにより異なると考えられる ため どのようにX方向配線のグループを設定するかに 関しては、前紀の条件を勘案して適宜定めるべきであ

> 【0095】本実験形態の方法により作成した画像形成 装置も、実施形態7の場合と同様に良好な画像が表示さ れることが確認された

[0096]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、フォーミ となるように導入量を制御した。この状態で、X方向配 30 ング工程の処理時間を知識することが出来る。又、本発 明によれば、フォーミング時の発熱は、基板の一部分に 集中することがなく、基板上で概ね均一にすることがで さるので、基板の変形・破壊を防止することができる。 又、本発明によれば、電子運が大型になった場合にも、 **還元性ガス中でフォーミング処理を施すことが可能とな** り、良好な特性の大型の電子源、およびそれを用いた画 億形成装置を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の製造方法を実施するための装置の一例
- 【図2】実施形態1の方法における、X方向配線の選択 の仕方と、フォーミング時の基板の温度分布を説明する 図である.
- 【図3】実施形態1のフォーミング処理に用いる、パル ス電圧を説明する模式図である。
- 【図4】実施形態1のフォーミング工程を説明するフロ ーチャートである。
- 【図5】本発明の製造方法を実施するための装置の別の 一例を示すプロック図である。

たものより大型のもので、X方向配線は480本、Y方 50 【図6】実施形態2の方法における、バルス電圧の印加

23

方法を説明するための模式図である。

【図7】実施形態3の活性化工程でのX方向配線のグル ープ化方法を示す図である。

【図8】画像形成装置の構成を説明するための模式図で

【図9】実施形態3の方法におけるX方向配線の選択の 仕方を説明する図である.

【図10】表面伝導型電子放出素子の構成を説明するた

めの模式図、平面図である。 【図11】表面伝導型電子放出業子の構成を説明するた 10 1007 フェースアレート

めの模式図、断面図である。 【図12】電子源の構成を説明するための模式図であ

【図13】実施形態で作成した電子源の一部上面模式図

である.

【図14】蛍光体の配列形態を示す模式図である。 【図15】実施形態で作成した電子放出素子の作成プロ

セスを示す断面模式図である。

【図16】活性化工程で用いられる電圧波形を示す模式 図である。

【図17】実施形態でのX方向配線のグループ化方法、 およびフォーミング電圧の印加順序を説明するための図 である.

【図18】実練形態で作成した電子源の作成プロセスを 示す一部上面模式図である。

【図19】実施形態で作成した電子源の作成プロセスを 示す一部上面模式図である。

【図20】課題を説明するための図である。

【符号の説明】 11 電子源

12 X方向配線 13 Y方向配線

1.4 配線切換器

15 フォーミング電圧発生器

16 制御装置 17 電流計

18 電子放出業子

1001 基板

1002 表面伝導型電子放出素子

2.4

1003 X方向配線 1004 Y方向配線

1005 リアプレート

1006個壁

1008 蛍光膜

1009 メタルバック

1010 黑色都材

1102, 1103 案子電極

1104 導電性膜

4102 X方向配緯 4103 Y方向配線

【要約】

【課題】 多数のX方向配線を有する電子派の電子放出 20 部を短時間でフォーミングするとともに、フォーミング 時の基板の変形・破壊を防止する。

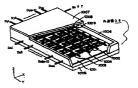
【解決手段】 Y方向配線13は共通のグランドに接続 し、X方向配線12は配線切り替え器14に接続する。 X方向配線はグループ化され、たとえば10本で一つの グループを構成し、グループ1はDx1、Dx103. Dx205, ..., IN-T2HDx2. Dx10 4. Dx206···等とする。Dx1に1パルス印加 した後、Dx103に1パルス印加し、更にDx205 に接続を切り替える。グループ1のすべての配線に1パ

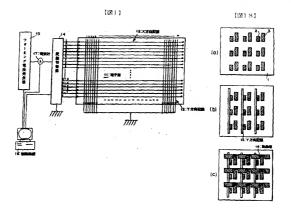
30 ルスずつ印加した後、再びD×1に接続を切替、同様の 工程を繰り返す。このパルス印加の繰り返しによって、 グループ1のフォーミング処理が完了したら、グループ 2についても同様の処理を行う、これを繰り返して、す バての電子放出業子のフォーミング処理を容了させる

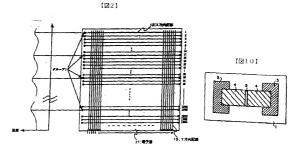
【図111



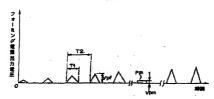
[28]



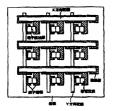




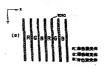
[23]



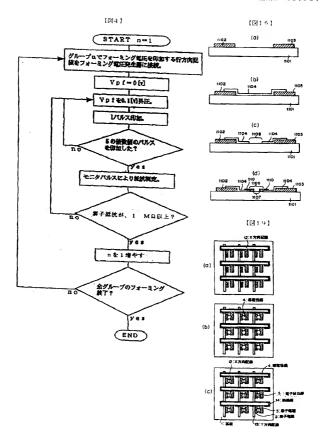
(**2**13]



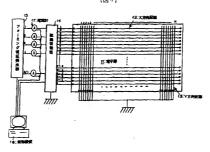
[214]

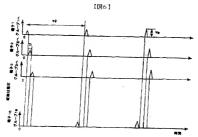


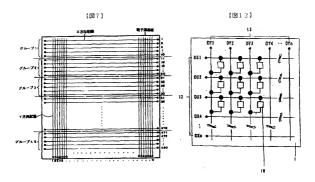


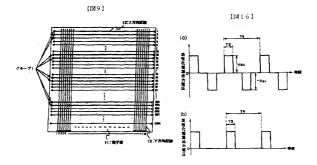


[25]

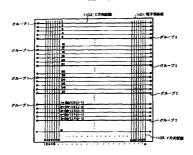




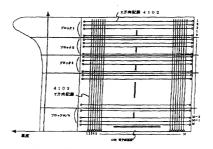




[2]17]



[M20]



フロントページの続き

(72)発明者 河出 -佐哲

ヤノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目90番2号 キ (56)参考文献 特開 平7~176265;3 F. A) 特開 平9 - 298029 (JP、A)

> (58)調査した分野(Int.CL<sup>2</sup>, DB名) H01J 9/02